



SPUR Photochemie
Dr. Heidrich und Schain GbR
Schmiedestr. 31, D-52379 Langerwehe
Tel.: 02423-6198 Mobil: 0173-7086525
Fax: 02423-406980
Website: www.spur-photo.com
E-Mail: schain@spur-photo.com
Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. Heribert Schain

Neu: Das ideale Traumpaar

**Mit dem neue Entwickler SPUR Nanotech UR
erzielt der höchstaflösende Dokumentenfilm SPUR Orthopan UR
sensationell hohe Empfindlichkeiten bis zu ISO 50/18°**

vorge stellt beim fineartforum 2017 in Paderborn

Hochauflösende bildmäßige SW-Fotografie mit Dokumentenfilmen

Hochauflösende Dokumentenfilme sind seit langem durch neue SPUR Entwicklungsverfahren für die bildmäßige SW-Fotografie erschlossen worden. Aufgrund neuester Forschung und Entwicklungsergebnisse und einer präzisen Abstimmung von Filmemulsion und Entwickler konnte die bisher einzige Einschränkung, nämlich die relativ geringe Empfindlichkeit der Hochauflösungsverfahren, beseitigt werden.

Mit dem neuen Entwickler **SPUR Nanotech UR** für den höchstaflösenden Dokumentenfilm **SPUR Orthopan UR** lassen sich nunmehr bei diesem Film (KB) Empfindlichkeiten zwischen ISO 6/9° und ISO 50/18° erreichen. Dabei resultieren bis einschließlich ISO 25/15° normale Tonwerte bei normalem Kontrast, ab ISO 40/17° resultiert ein N + 1 Kontrast mit etwas steileren Lichtern.

Beim Rollfilm lässt sich als höchste Empfindlichkeit ISO 40/17° erreichen. Hier sind die Lichter bei den höchsten Empfindlichkeiten bei einem Kontrast von N + 0,5 noch etwas moderater.

Der Verlust an Schattenzeichnung ist selbst bei der höchsten erreichbaren Empfindlichkeit relativ gering.

Die Qualitätsmerkmale des früheren SPUR-Entwicklers Nanospeed SL werden mit dem Nanotech UR mindestens eingehalten und meist übertroffen: Die Kornvergrößerung ist selbst bei der höchsten erreichbaren Empfindlichkeit von ISO 50/18° so gering, dass sie erst bei ca. 50facher Vergrößerung festgestellt werden kann. Detailkontrast und Schärfe sind deutlich besser als beim bisherigen Nanospeed SL. Die erzielte Bildqualität mit dem Nanotech UR Entwicklungsverfahren wird bei dieser Empfindlichkeit von keiner anderen Film-Entwickler-Kombination erreicht.

Das bisherige Entwicklungsverfahren SPUR Nanospeed SL ist ab sofort nicht mehr lieferbar.